

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年10月5日(05.10.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/189116 A1

(51) 国際特許分類:
C23C 4/12 (2016.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/007341

(22) 国際出願日: 2023年2月28日(28.02.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-052502 2022年3月28日(28.03.2022) JP

(71) 出願人: 日本発條株式会社(NHK SPRING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2360004 神奈川県横浜市金沢区福浦三丁目10番地 Kanagawa (JP).

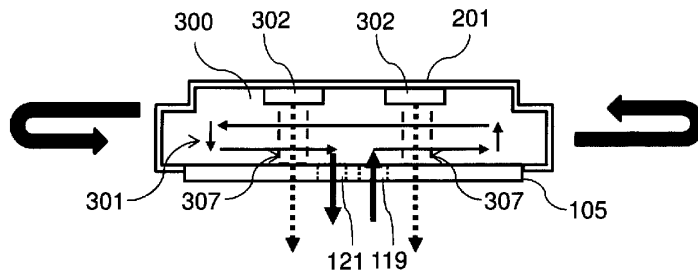
(72) 発明者: 平野 智資(HIRANO Satoshi); 〒2360004 神奈川県横浜市金沢区福浦三丁目10番地 日本発條株式会社内 Kanagawa (JP). ▲高▼原 剛(TAKAHARA Go); 〒2360004 神奈川県横浜市

金沢区福浦三丁目10番地 日本発條株式会社内 Kanagawa (JP). 南部 貴俊(NAMBU Takatoshi); 〒2360004 神奈川県横浜市金沢区福浦三丁目10番地 日本発條株式会社内 Kanagawa (JP). 金田 教良(KANEDA Noriyoshi); 〒2360004 神奈川県横浜市金沢区福浦三丁目10番地 日本発條株式会社内 Kanagawa (JP). 横山 響(YOKOYAMA Hibiki); 〒2360004 神奈川県横浜市金沢区福浦三丁目10番地 日本発條株式会社内 Kanagawa (JP). 曾根 通介(SONE Michiyoshi); 〒2360004 神奈川県横浜市金沢区福浦三丁目10番地 日本発條株式会社内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人高橋・林アンドパートナーズ(TAKAHASHI, HAYASHI AND PARTNER PATENT ATTORNEYS, INC.); 〒1440052 東京都大田区蒲田5-24-2 損保ジャパン蒲田ビル9階 Tokyo (JP).

(54) Title: ROTARY DEVICE AND SPRAY DEVICE

(54) 発明の名称: 回転装置及び溶射装置



(57) Abstract: This rotary device comprises: a rotary stage which detachably supports a base material having an inlet and an outlet for a liquid having a predetermined temperature, and a flow path connecting the inlet to the outlet; a rotary support which supports a rotary table; a rotary mechanism which rotates the rotary support; and a liquid supply part which supplies the liquid to the base material. The rotary stage has a liquid supply port for supplying the liquid to the base material, and a liquid discharge port for discharging the liquid from the base material. The rotary support has therein a first pipe connected to the liquid supply port, and a second pipe connected to the liquid discharge port. In addition, this spray device comprises the rotary device and a spray gun.

[続葉有]

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO(BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約: 回転装置は、所定の温度の液体の流入口、流出口、及び前記流入口及び前記流出口を繋ぐ流動経路を有する基材を着脱可能に支持する回転ステージと、前記回転テーブルを支持する回転支柱と、前記回転支柱を回転させる回転機構と、前記基材に前記液体を供給する液体供給部と、を備え、前記回転ステージは、前記液体を前記基材に供給する液体供給口、及び前記基材から液体を排出する液体排出口を有し、前記回転支柱は、内部に、前記液体供給口に連結する第1配管、及び前記液体排出口に連結する第2配管を有する。また、溶射装置は、上記回転装置と、溶射ガンと、を備える。